

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第2区分

【発行日】平成29年10月19日(2017.10.19)

【公開番号】特開2016-58446(P2016-58446A)

【公開日】平成28年4月21日(2016.4.21)

【年通号数】公開・登録公報2016-024

【出願番号】特願2014-181471(P2014-181471)

【国際特許分類】

H 01 L 21/304 (2006.01)

H 01 L 21/306 (2006.01)

【F I】

H 01 L 21/304 6 4 3 A

H 01 L 21/306 R

【手続補正書】

【提出日】平成29年9月6日(2017.9.6)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

基板を収容し、収容した前記基板の処理対象面に向けて清浄な空気が流れる処理室と、前記処理室内の前記基板の処理対象面に処理液を供給するノズルと、

前記空気の流れを妨げる位置から前記処理室内の前記基板の処理対象面を加熱する加熱部と、

前記空気の流れを妨げる位置から前記空気の流れを妨げない位置に前記加熱部を移動させる移動機構と、

を備えることを特徴とする基板処理装置。

【請求項2】

前記移動機構は、前記ノズルにより前記処理液が前記処理室内の前記基板の処理対象面に供給されている状態で、前記空気の流れを妨げる位置から前記空気の流れを妨げない位置に前記加熱部を移動させることを特徴とする請求項1に記載の基板処理装置。

【請求項3】

前記加熱部は、前記処理室内の前記基板の処理対象面に前記処理液を供給している状態の前記ノズルを避けて移動するための切欠き部を有していることを特徴とする請求項2に記載の基板処理装置。

【請求項4】

前記加熱部は、前記加熱部の端部を回転中心として回転可能に形成されており、

前記移動機構は、前記加熱部を回転させて前記空気の流れを妨げる位置から前記空気の流れを妨げない位置に前記加熱部を移動させることを特徴とする請求項1乃至請求項3のいずれか一項に記載の基板処理装置。

【請求項5】

前記加熱部は、複数に分割可能に形成されており、

前記移動機構は、前記加熱部を複数に分割して前記空気の流れを妨げる位置から前記空気の流れを妨げない位置に移動させることを特徴とする請求項1乃至請求項4のいずれか一項に記載の基板処理装置。

【請求項6】

前記処理室は、複数設けられており、

前記ノズルは、前記処理室ごとに設けられており、

前記移動機構は、前記複数の処理室のうち第1の処理室の前記空気の流れを妨げる位置から、前記第1の処理室の前記空気の流れを妨げない位置として前記第1の処理室以外の第2の処理室の前記空気の流れを妨げる位置に前記加熱部を移動させることを特徴とする請求項1乃至請求項3のいずれか一項に記載の基板処理装置。

【請求項7】

基板を収容する処理室内の前記基板の処理対象面に向けて清浄な空気を流す工程と、

前記空気が前記処理室内の前記基板の処理対象面に向かって流れている状態で、前記処理室内の前記基板の処理対象面に処理液を供給する工程と、

前記処理液を供給する工程前又は途中から、前記空気の流れを妨げる位置に存在する加熱部により前記処理室内の前記基板の処理対象面を加熱する工程と、

前記空気の流れを妨げる位置から前記空気の流れを妨げない位置に前記加熱部を移動させる工程と、

を有することを特徴とする基板処理方法。

【請求項8】

前記加熱部を移動させる工程では、前記処理液が前記処理室内の前記基板の処理対象面に供給されている状態で、前記空気の流れを妨げる位置から前記空気の流れを妨げない位置に前記加熱部を移動させることを特徴とする請求項7に記載の基板処理方法。

【手続補正2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0008

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0008】

実施形態に係る基板処理装置は、基板を収容し、収容した前記基板の処理対象面に向けて清浄な空気が流れる処理室と、前記処理室内の前記基板の処理対象面に処理液を供給するノズルと、前記空気の流れを妨げる位置から前記処理室内の前記基板の処理対象面を加熱する加熱部と、前記空気の流れを妨げる位置から前記空気の流れを妨げない位置に前記加熱部を移動させる移動機構とを備える。